環状明視野(ABF)STEM 法の理論と応用

Theory and Application of Atomic-Resolution Annular Bright-Field (ABF) STEM

柴田 直哉^{a, b}, フィンドレイ スコット^a, 幾原 雄一^{a, c} Naoya Shibata, Scott D. Findlay and Yuichi Ikuhara

> ^a東京大学大学院工学系研究科総合研究機構 ^b科学技術振興機構 さきがけ研究員 ^cファインセラミックスセンター ナノ構造研究所

要 旨 収差補正 STEM 法は、原子レベルの材料解析において極めて有力な手法である. STEM 法では主に高角度散乱された電子を選択的 に検出する HAADF 法が用いられてきたが、HAADF 法は像コントラストが原子番号に強く依存するため、軽元素と重元素の同時観 察には不向きであった. 最近,低角度散乱された電子を環状検出器で検出する環状明視野(ABF)法により,結晶中の軽元素を極 めて明瞭に観察できることが示され,材料解析への応用が期待されている.本稿では、ABF STEM 法の特徴と像形成理論を概説す るとともに、最近のアプリケーション例についても紹介する.

キーワード:走査透過型電子顕微鏡 (STEM), ABF法, 軽元素観察

1. はじめに

水素(H), リチウム(Li), 炭素(C), 窒素(N), 酸素(O) など軽元素は、様々な材料、デバイスの重要な構成元素であ り、その構造や挙動を理解することは材料特性を理解する上 で極めて重要である。例えば、O やその欠陥は酸化物の電子 物性を支配する重要な元素であり、Li や H は次世代の電池 材料、エネルギー材料において鍵となる元素である。また、 炭素はフラーレン、ナノチューブ、グラフェンなど一連の炭 素系ナノ材料の構成元素であり、そのナノレベルの構造が物 性に決定的な影響を与えることが知られている.このように、 次世代の材料開発には材料中の軽元素の構造を原子レベルで 理解することが不可欠であり、電子顕微鏡分野において様々 な方法による軽元素の原子直接観察が試みられてきた。しか し、電子の散乱能が極めて小さい軽元素を原子レベルで観察 することは一般に容易ではなく、特に軽元素と重元素が混在 する化合物中の軽元素観察は困難であった。

近年,収差補正技術の発展により分解能及び感度が著しく 向上し,電子顕微鏡による原子レベルの軽元素構造観察が現 実的となってきた.例えば,Urbanらのグループは,負の球 面収差(negative Cs)を利用する高分解能電子顕微鏡法 (HRTEM)により,酸化物中の酸素原子構造を明瞭に観察 する方法を提案している^{1,2)}.この方法を用いることにより, 酸化物界面の酸素構造を解析することに成功している²⁾.し かし,本手法では非常に薄い試料(<10 nm)を必要とし, イメージシミュレーションによる像解析が不可欠となる.一 方、収差補正機を利用した走査透過型電子顕微鏡 (STEM) 法では、高角度に散乱された電子を選択的に検出し像を形成 することにより(HAADF法),広範囲の試料厚において像 コントラストから直接原子構造を決定することができる³⁾. これは界面などの局所的に乱れた原子構造を解析する上で大 きな利点となるが、コントラストが原子番号に強く依存する (~Z²に比例)ため,軽元素と重元素が混在する場合,軽元 素の情報を得ることは一般に困難である. 最近では, STEM 法と電子エネルギー損失分光法(EELS)を組み合わせるこ とで、単原子カラムレベルの 2D EELS マッピングが実現 し4~6, 軽元素原子カラムの検出も可能になりつつある. し かし、現時点では単原子カラムレベルに絞った電子プローブ からの EELS 信号は小さく、繰り返しスキャンによる信号積 算や信号処理技術によるデータ処理が必要であり,界面など の欠陥構造における軽元素構造の観察は未だ困難を伴う.

最近,原子分解能 STEM において,明視野領域における 低角度散乱された電子を環状検出器で検出する環状明視野 (annular bright-field: ABF) 法により(図1),酸化物や窒化 物中の酸素サイトや窒素サイトを他の重元素サイトと同時に 観察できる可能性が報告され^{7~9},材料中の軽元素原子構造 を解析する手法として注目が集まっている.本手法は従来の HAADF 法や EELS 法とも併用することができ,一回のスキャ ンで材料中のすべての元素カラムの情報を取得できる可能性 がある.本稿では,原子分解能 ABF STEM 法の理論を概説 するとともに,ABF STEM 法を用いた最近のアプリケーショ ン例について紹介する.

^a〒113-8656 東京都文京区弥生 2-11-16 TEL: 03-5841-7756; FAX: 03-5841-7694 2010年12月13日受付



図 1 STEM における ABF 及び HAADF 検出器ジオメトリー の模式図

2. ABF STEM 法の像形成理論

STEM 法による検出器ジオメトリーと像形成に関してはす でに多くの実験及び理論的検証がなされており,ABF に類 似する方法に関してもコントラスト伝達関数の議論から,情 報限界が向上することが示されている^{10,11}.しかし,原子分 解能 ABF STEM 法の像形成に関する詳細な検討及び軽元素 原子の結像性に関しては報告されておらず,筆者らのグルー プが中心となって計算機シミュレーション手法を用いた像形 成理論に関する研究を行ってきた^{8,9}.本節ではその内容の エッセンスを概説し,本手法の特徴を議論する.

2.1 原子分解能 STEM における BF 法, ABF 法, HAADF 法の比較

図2に, Bloch wave 法に基づくシミュレーションにより 得られた異なる検出角度領域における STEM 像の試料厚― デフォーカス依存性マップを示す. 試料は SrTiO₃[110] であ り, 検出領域は(a) BF: 0-4 mrad, (b) ABF: 11-22 mrad, (c) HAADF: 81-228 mrad である. プローブの収束半角は 22 mrad,加速電圧 200 kV として計算を行った.BF STEM では、像コントラストが試料厚及びデフォーカス量に大きく 依存し、条件によっては原子位置のコントラストが明暗反転 することがわかる. これは STEM と TEM の相反性から, BF STEM では通常の HRTEM と同様の試料厚―デフォーカ ス依存性を示すことで理解できる. つまり, BF STEM 像の みから原子位置を議論するためには, HRTEM と同様にス ルーフォーカスによる系統的な像観察及びシミュレーション との比較が不可欠となる.一方, HAADF STEM では、広範 囲の試料厚及びデフォーカス量に対して原子位置が常に明る いコントラストで結像される.つまり.明るいコントラスト の位置から原子カラム位置を直接同定することが可能であ



図2 原子分解能 SrTiO₃[110] 像の各検出角度による試料厚— デフォーカス依存性. (a) BF:0-4 mrad, (b) ABF:11-22 mrad, (c) HAADF:81-228 mrad.

る.しかし、O原子カラムに関してはその強度が弱いため、 コントラストの強い Sr 及び Ti-O カラムによってマスクされ てしまう. ABF STEM では、Sr、Ti-O、O 原子カラムがい ずれもバックグラウンドに対して暗いコントラストを呈し、 そのコントラストは概ねカラム元素の種類に依存する(但し, その依存性は常に一定ではない). 重要なことは、非常に広 範囲の試料厚に亘って常に原子カラム位置が暗いコントラス トで結像される点である. HAADF に比べて ABF 像はデ フォーカス量に対する依存性はやや強いといえるが、それで も正焦点近傍±3nm までは試料厚が変化してもほぼ同様の コントラストを示すことがわかる. したがって、ABF 像で 正焦点近傍にフォーカスを合わせることができれば、像コン トラストから原子カラム位置を直接同定できる. つまり. ABF 法は軽元素原子カラムを明瞭に観察できるとともに, HAADF 法と同様に像から直接原子構造を議論することがで きる手法であるといえる.以下に、このようなABF 法の像 形成メカニズムを理論的に検証する.

2.2 ABF STEM法による原子カラムの結像メカニズム^{8.9} ABF 検出器によるコントラスト形成メカニズムを理解す るためには、検出器面上での散乱電子の振る舞いを理解する ことが重要である.つまり、ABF 像の試料厚依存性やデ フォーカス依存性とはABF 検出器で検出する散乱電子の試 料厚、デフォーカス依存性と等価である.実際の結晶中には 軽元素及び重元素の原子カラムが混在し、ABF 信号の依存 性の理解には入射電子プローブの試料内部における非常に複 雑な散乱現象を厳密に解析する必要がある.しかし、ここで はABF 像形成の主要因を明快にすることを目的として、仮 想的な構造に対して s-state モデル^{12,13)}を適応した議論を展 開する.s-state モデルとは、入射電子の波動関数を原子カ ラムに局在した固有状態(電子軌道における s 軌道とのアナ ロジー)とそれ以外のバックグラウンドに分解できると近似 して試料中の高速電子の伝播を取り扱う手法である.STEM プローブが原子カラム直上に入射したとき、そのカラムの s-state が強く励起され、電子は原子カラムに沿ってチャネ リングする.この s-state とバックグラウンドの挙動に着目 することにより ABF STEM 像形成を定性的に理解すること を目指す.しかし、原子カラム同士が近すぎる(s-state 同 士がオーバーラップする)場合にはこのモデルが成り立たな くなるとの報告があり¹⁴⁾、したがって、s-state のオーバーラッ プの小さい場合との限定があることに注意して頂きたい.

入射電子プローブが原子カラム直上に存在するとき,逆空間における波動関数は試料中の伝播距離zの関数として以下のように近似できる¹²⁾.

$$\Psi_{0}(\mathbf{q}, z) \approx \alpha \Phi_{1s}(\mathbf{q}) \exp\left[-i\pi \frac{E_{00}}{E_{0}} z/\lambda\right] + \left[A(\mathbf{q}) - \alpha \Phi_{1s}(\mathbf{q})\right] \exp\left[-i\pi \lambda q^{2} z\right]$$
(1)

但し、 Φ_{1s} は s-state の波動関数、 α は s-state の励起振幅、 E_{00} は s-state の固有エネルギー (負の値), E_0 は加速電圧, A は逆空間におけるプローブの振幅(収差の無い場合は tophat 関数になる)、 λ は電子線の波長、qは逆空間における2 次元座標を示す.(1)式の第一項に示すように、s-state は z に依存した phase factor によって伝播し、第二項に示す s-state 以外のバックグラウンドについては、その z 依存性を 試料ポテンシャルからの影響が無く真空中を伝播する場合を 仮定することとした.このような表現を用いることにより, 検出面上の強度を式(1)の右辺の2つの項の干渉として考 えることができる.以下に示す理論計算では、0原子カラム のみからなる仮想的な周期構造を仮定した計算を展開する. このモデルでは、電子線入射方向の0原子間隔及び0の平 均二乗振幅をSrTiO₃[110]と等しい(それぞれ2.8Åと 0.0093 Å²) と仮定して計算を行った.また.軽元素を対象と することから熱散漫散乱による高角散乱は無視できると仮定 した.

図3(a)に、O原子カラム直上に電子プローブを置いた場 合の検出面上に形成される電子回折図形の強度を、光軸から の角度 β 及び試料厚に対してプロットしたグラフを示す.こ の結果は Bloch wave 法によって計算された結果(b)とも良 い一致を示しており、s-state モデルを用いた議論の妥当性 を示している.前節で示したように、ABF 像は原子カラム 位置が暗いコントラストで結像されることから、ABF 検出 器に用いた β = 11-22 mrad の範囲では強度が減少しているは ずである.一方、入射した電子はトータルでは保存されるは ずであり、従ってその分だけ強度が上昇する角度領域が存在 するはずである.図から明らかなように、広い試料厚さの範 囲にわたって低角領域(β < 10 mrad)で強度が増大する傾向 にあることがわかる.つまり、入射電子は原子カラム上をチャ ンネルし、ABF 検出器の内孔部に高い強度を与えることを 示している.



図3 計算機シミュレーションによる ABF 領域への散乱強度 と試料厚の関係. (a) s-state モデルによる計算, (b) Bloch wave 法による計算, (c) 式 (1) 中の $\alpha \Phi_{1s}$, A, A- $\alpha \Phi_{1s}$ を散乱 角度に対してプロットしたグラフ.

図3(c)は原子カラム上にプローブを入射した際の式(1) 中のαΦ₁, A, A-αΦ₁,を散乱角度に対してプロットした図 を示す. 吸収効果及びプローブの収差を考慮しない場合, $\alpha \Phi_{1s}$, A, A- $\alpha \Phi_{1s}$ はいずれも実数の関数として表わされる. ここで、各散乱角度領域で検出される像強度は式(1)の第 一項と第二項を足し合わせたものの絶対値の2乗で表わされ る. $\alpha \Phi_{1s}$, A- $\alpha \Phi_{1s}$ には phase factor が掛け合わされているため, 第一項及び第二項は試料中を伝播する際の位相変化も含んで いるが、ここでは $\alpha \Phi_{1s}$, A- $\alpha \Phi_{1s}$ に着目して議論する. これ は言いかえればz=0における第一項と第二項の関係を示し ている.まず、散乱角度範囲を以下の3つに分解してそれぞ れの特徴を示す.まず $\beta = 0 - \sim 10$ mrad の範囲では、 $\alpha \Phi_{1s}$ と A- $\alpha\Phi_1$,の位相は π ずれており、 $\alpha\Phi_1$,とA- $\alpha\Phi_1$,の干渉はその 強度を弱め合う.しかし,電子線が試料中を伝播する過程で, 各 phase factor による位相変化が生じることにより、常に $\alpha \Phi_{1s} \ge A - \alpha \Phi_{1s}$ の干渉は z = 0 の場合に対してその強度を強 め合うことになる. これが, 図3(a) に示した <~10 mrad の領域で散乱強度が増加する理由である.次に、β=~10-22 mrad の範囲では、 $\alpha \Phi_{1s} \ge A - \alpha \Phi_{1s}$ は共に正の値を取り、同位 相となるため強め合っている.しかし,電子線が試料中を伝 播する過程で位相変化を起こすことにより、αΦ₁。とA-αΦ₁。 の干渉はz=0の場合に対して常にその強度を弱め合うこと になる. 最後に $\beta > 22$ mrad の範囲では, $\beta = 0 - -10$ mrad の 範囲と同様に $\alpha \Phi_{1s}$ と A- $\alpha \Phi_{1s}$ の位相は π ずれており, 電子線 が試料中を伝播する過程で $\alpha \Phi_{1s}$ とA- $\alpha \Phi_{1s}$ の干渉はz=0の 場合に対してその強度を強め合うことになる. 以上をまとめ ると、試料中の電子線の伝播に伴って、β=0-~10 mrad 及 び β > 22 mrad の範囲では、常に z = 0 の場合に対してその強 度が上昇するのに対して、 $\beta = \sim 10-22 \text{ mrad}$ の範囲では、そ の強度が減少する.もちろん散乱角度によって式(1)の2つ

の項の相対的な位相変化量は変化するため、伝播過程で干渉 による強度の振動が観察されるが、z=0を基準にすれば、 上述の議論は常に成り立つことになる. これが、β=~10-22 mrad 範囲の信号を用いて結像する ABF 像の原子カラムが常 に暗いコントラストを示す理由であり、試料厚が変化しても コントラストに反転現象が起こらない要因であると考えられ る、一般に、s-stateの波動関数は原子番号依存性が小さいた め¹³⁾、このモデルによる説明は多くの原子に対して基本的に 成り立つものであるが、以下の場合については必ずしも主要 因とはならない点に注意が必要である.まず,重元素の場合、 今回のモデルでは取り入れなかった熱散漫散乱により高角側 への散乱が顕著になる.この結果,明視野領域の強度を著し く弱めることが ABF の暗いコントラストの主要因となる⁹. また、原子番号が非常に小さい H や Li の場合、s-state のオー バーラップが顕著になるため、今回のモデルを用いた単純な 解釈は必ずしも当てはまらない可能性がある.

2.3 ABF STEM 法の特徴とまとめ

以上の内容を基に、原子分解能 ABF STEM 法における像 形成メカニズムを以下にわかりやすく説明する. 図4に軽 元素及び重元素原子カラムからの散乱電子と ABF 検出器の 関係を模式的に示す.まず、(a) に示す原子カラム間に電子 プローブを入射した場合、電子プローブは試料下面に向って 伝播し、特定の原子カラム上をチャンネルせず ABF 検出器 で検出されることになる.一方(b)に示す軽元素原子カラ ム上に電子プローブを入射した場合、入射電子は原子カラム 上を鋭くチャネリングしながら試料下面へと伝播する.しか し、原子番号が小さいため高角度散乱される電子の割合が少 なく、入射電子の大部分が低角散乱領域に存在する. しかし、 その大部分は ABF 検出器の内孔を通過してしまうため、先 程の原子カラム間に電子プローブを入射した場合に比べて ABF 信号は弱くなり、原子カラム位置が暗いコントラスト で結像されることになる.また.(c)に示す重元素原子カラ ム上に電子プローブを入射した場合、入射電子は原子カラム



図4 電子プローブを試料に入射した際の挙動及びABF 検出 器上で検出される散乱電子を示す模式図.(a)電子プローブを 原子カラムの間に入射した場合,(b)電子プローブを軽元素カ ラム直上に入射した場合,(c)電子プローブを重原子カラム上 に入射した場合.

上を伝播する過程で高角度領域に強く散乱される.重元素で はこのような広角散乱電子の寄与のために ABF 検出器に到 達する信号が弱まり,原子カラム位置がバックグラウンドに 対して暗いコントラストで結像される主要因となる.このよ うに ABF 法では像コントラストの主要因が軽元素,重元素 で異なる点が大きな特徴であり,軽元素と重元素の同時観察 を可能にする要因であると考えられる.反面,このような特 徴は HAADF のような原子番号に対する像コントラストの簡 単なスケーリング則を成り立たせない原因ともなりうるが, 詳細な理論計算による試算では、特殊な条件下においては広 範な元素に対して像コントラストが約 Z^{1/3} の原子番号依存性 を有する可能性が示めされている⁹.

3. ABF STEM 法の応用例

本節では実際の収差補正 STEM を用いて実験的に観察さ れた各種化合物の原子分解能 ABF STEM 像を示す. 図 5 に は同時計測された各種結晶の HAADF 像及び ABF 像を示 $す^{8,9)}$. また対応するシミュレーション像及び原子構造モデ ルも示す. まず,酸化物である (a) (b) TiO₂, (c) (d) SrTiO₃, (e) (f) Al₂O₃ において, ABF 像では O 原子カラム



図5 各種化合物結晶の原子分解能 HAADF 及び ABF STEM 観 察 例. (a) (b) TiO₂[001], (c) (d) SrTiO₃[110], (e) (f) Al₂O₃[1-210], (g) (h) c-BN[110].

が明瞭に観察できていることがわかる. これに比べて HAADF像では重い元素のカラムは観察できるものの, O原 子カラムについては信号が弱すぎるため観察できていない. 次にBとNからなる c-BNの観察結果を(g)(h)示す. HAADF及び ABF像ともに軽元素原子カラムが直接観察さ れているが, ABF像のほうがより明瞭なコントラストで軽 元素原子カラムを結像している. これは, ABFは HAADF に比べて高い S/Nで軽元素原子カラムを観察できることを 示唆している.

このような ABF STEM 法の優れた軽元素観察能により、 更に原子番号の小さい元素観察への応用が期待される. 2009 年来 Li 電池開発に必須の Li 系電極材料中の Li 原子の ABF STEM 直接観察が相次いで報告され^{15,16)}、理論計算によ る理論的検証と合わせて Li 原子カラムの直接観察が可能で あることが示されている.そして,最も軽い元素であるH 原子カラムの直接観察が次の焦点であったが、最近、水素化 物中の水素原子カラムの直接観察が報告された^{17,18)}.水素化 バナジウム(VH。)は水素吸蔵材料としての応用が期待され ており、材料内部における H 原子の吸放出挙動が極めて重 要な材料学的問題である.VH2の結晶構造はV原子による 副格子が面心立方構造を有しており、その四面体空隙を H が占有する構造となる. この結晶を「001〕方向から観察し た HAADF 像及び ABF 像(共にフィルター処理を施してい る¹⁷⁾)を図6に示す. HAADF 像中の明るいコントラストは V原子の存在位置に対応しており、ABF 像ではその間に存 在する H 原子カラムの存在位置に弱い暗コントラストが観 察されていることがわかる. つまり, Η原子位置には暗いコ ントラストが存在していることがわかる. このコントラスト がH原子カラムの存在に起因する信号なのかを検証するた めに, Bloch wave 法による理論解析を行った. 図7に, (a) VH₂及び(b) VH₂中のH原子をすべて抜きとったV結晶を 「001〕 方向から ABF STEM 観察した際の試料厚―デフォー カス依存性マップを示す.いずれのモデル構造においてもV 原子カラム位置には明瞭な暗コントラストが生じており、こ れはV原子カラムの存在に起因すると解釈できる.一方, VH。においては試料厚さ100Å以下の領域においてH原子 位置に弱い暗コントラストが発生しているが, H原子を意図



図6 [001] 方向から同時観察した VH₂ の(a) HAADF 像及び(b) ABF 像. どちらの像もノイズを低減するためフィルタリング 処理を施している. 緑丸が V, 青丸が H を示す.

的に抜きとった構造においては、ここで計算した全ての試料 厚領域にわたって H 原子位置には暗コントラストが生じて いない. この結果は、H 原子位置に弱い暗コントラストが発 生している原因が、H 原子カラムの存在に起因することを示 しており、本研究で観察されたコントラストは H 原子カラ ムの存在を直接示すものであると解釈できる. つまり、ABF STEM 法を用いることにより、H 原子カラムを直接観察でき たと結論できる.

近年,低炭素化社会を目指した材料開発にますます拍車が かかり,これまで観察が不可能であった H や Li 原子の直接 観察を可能にする ABF STEM を用いることにより,軽元素 原子を高度に制御した新しい電池材料,エネルギー材料開発 が可能になることが期待される.また,ABF STEM 法を積 極的に材料解析に利用する試みが既に報告され始めており, 界面などの局所的に構造が乱れた領域においても軽元素構造 を決定できる可能性が報告されている^{19,20)}.本稿で示したよ うに,ABF STEM では HAADF と同様に原子カラム位置を 直接決定できるため,様々な材料分野への応用が期待できる.

4. おわりに

原子分解能 ABF STEM 法は、軽元素原子カラムと重元素 原子カラムを同時に観察することを可能にし、これまで困難 であった材料内部の軽元素構造を直接決定する新しいツール になることが期待される.また、ABF STEM 法により H 原 子カラムの直接観察が実験的に示されたことは、顕微鏡学者 の長年の夢であった全元素対応型原子分解能電子顕微鏡の実 現を意味しており、大変意義深い.ABF STEM 法をはじめ STEM における多種多様な検出器ジオメトリーの探索と新し いイメージング法の開拓は、過去に精力的に行われており、 ABF 以外にもユニークな検出器ジオメトリーによる新奇な 情報抽出の可能性が予測されている^{10,11,21)}.しかし、このよ



図7 Bloch wave 法に基づく ABF STEM 像シミュレーション 結果. (a) VH₂ 及び (b) VH₂ から H を完全に取り除いた結晶 モデルを用いた試料厚―デフォーカス依存性.

うな多様な検出器ジオメトリーの原子分解能 STEM への応 用は全くの未開拓領域であり、収差補正 STEM の導入によ り空間分解能および感度が著しく向上した今こそ取り組むべ き新しいフィールドであると考えられる.筆者らのグループ では最近原子分解能観察対応の多分割 STEM 検出器を開発 し、検出器上での位置・角度に依存した複数の原子分解能 STEM 像を1回のスキャンにより同時計測することに成功し ている²²⁾.このような新しい検出器システムにより特定の透 過散乱電子を意図的に選択し原子分解能 STEM 像を形成す ることで、これまで抽出が困難であった局所的な電磁場の情 報や結晶異方性に関する情報の抽出が期待できる.収差補正 STEM により極めて高い空間分解能が達成され、H 原子カラ ムまでもが直接観察できるようになった今、検出器ジオメト リーの再検討による STEM の更なる可能性に期待したい.

謝 辞

本稿で紹介した研究の一部は、東京大学の山本剛久博士, 日本電子株式会社の沢田英敬氏、奥西栄治氏、近藤行人氏と の共同研究により遂行されました.また、水素原子の直接観 察につきましては、(財)ファインセラミックスセンターナ ノ構造研究所および産業技術総合研究所との共同研究成果で あります.本研究の一部は最先端研究開発支援プログラム「高 性能蓄電デバイス創製に向けた革新的基盤研究」(中心研究 者 水野哲孝東大教授)及び新エネルギー・産業技術総合開 発機構平成19年度産業技術研究助成事業の助成の下遂行さ れました.ここに合わせて謝意を表します.

文 献

- 1) Jia, C.L. and Urban, K.: Science, 303, 2001 (2004)
- Jia, C.-L., Mi, S.-B., Urban, K., Vrejoiu, I., Alexe, M. and Hesse, D.: *Nature Mater.*, 7, 57 (2008)
- 3) Pennycook, S.J. and Jesson, D.E.: Ultramicroscopy, 37, 14 (1991)
- 4) Bosman, M., Keast, V.J., García-Muñoz, J.L., D'Alfonso, A.J., Findlay,

S.D. and Allen, L.J.: Phys. Rev. Lett., 99, 086102 (2007)

- Kimoto, K., Asaka, T., Nagai, T., Saito, M., Matsui, Y. and Ishizuka, K.: *Nature*, 450, 702 (2007)
- Muller, D.A., Kourkoutis, L. Fitting, Murfitt, M., Song, J.H., Hwang, H.Y., Silcox, J., Dellby, N. and Krivanek, O.L.: *Science*, 319, 1073 (2008)
- Okunishi, E., Ishikawa, I., Sawada, H., Hosokawa, F., Hori, M. and Kondo, Y.: *Microsc. Microanal.*, 15 Suppl. 2, 164 (2009)
- Findlay, S.D., Shibata, N., Sawada, H., Okunishi, E., Kondo, Y., Yamamoto, T. and Ikuhara, Y.: *Appl. Phys. Lett.*, 95, 191913 (2009)
- Findlay, S.D., Shibata, N., Sawada, H., Okunishi, E., Kondo, Y. and Ikuhara, Y.: Ultramicroscopy, 110, 903 (2010)
- 10) Rose, H.: Optik, 39, 416 (1974)
- 11) Cowley, J.M.: Ultramicroscopy, 49, 4 (1993)
- 12) Van Dyck, D. and Op de Beeck, M.: Ultramicroscopy, 64, 99 (1996)
- Geuens, P. and Van Dyck, D.: Adv. Imaging Electron Phys., 136, 111 (2005)
- Anstis, G.R., Cai, D.Q. and Cockayne, D.J.H.: Ultramicroscopy, 94, 309 (2003)
- 15) Huang, R., Ikuhara, Y.H., Moriwake, H., Kuwabara, A., Fisher, C.A.J., Ikuhara, Y., Mizoguchi, T. and Oki, H.: Proc. 22nd Fall Meet. Ceram. Soc. Jpn., 300 (2009)
- 16) Oshima, Y., Sawada, H., Hosokawa, F., Okunishi, E., Kaneyama, T., Kondo, Y., Niitaka, S., Takagi, H., Tanishiro, Y. and Takayanagi, K.: *J. Electron Microsc.*, 59, 457 (2010)
- 17) Findlay, S.D., Saito, T., Shibata, N., Sato, Y., Matsuda, J., Asano, K., Akiba, E., Hirayama, T. and Ikuhara, Y.: *Appl. Phys. Express*, 3, 116603 (2010)
- 18) Ishikawa, R., Okunishi, E., Sawada, H., Kondo, Y., Hosokawa, F. and Abe, E.: *Nature Mater.*, DOI: 10.1038/NMAT2957 (2011)
- Hojo, H., Mizoguchi, T., Ohta, H., Findlay, S.D., Shibata, N., Yamamoto, T. and Ikuhara, Y.: Nano Lett., 10, 4668 (2010)
- 20) Findlay, S.D., Azuma, S., Shibata, N., Okunishi, E. and Ikuhara, Y.: Ultramicroscopy, 111, 285–289 (2011)
- 21) Rose, H.: Ultramicroscopy, 2, 251 (1977)
- 22) Shibata, N., Kohno, Y., Findlay, S.D., Sawada, H., Kondo, Y. and Ikuhara, Y.: J. Electron Microsco., 59, 473 (2010)